(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-125337

(43)公開日 平成5年(1993)5月21日

(51) Int. C1. 5	5	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表	技術表示箇所				
C 0 9 J	7/00	JHN	6770 — 4 J							
	9/02									
	179/08	JGE	8830 — 4 J							
	183/08	JGG	8319 — 4 J							
H 0 1 B	1/20	D	7244 — 5 G							
	審査請求	未請求 請求	項の数 1		(全7頁) 最終頁	「に続く				
		_	11 11 1							
(21)出願番号 特願平3-287913				(71)出願人	000002141					
				1	住友ベークライト株式会社					
(22)出願日	平月	戎3年(1991)11	月1日		東京都千代田区内幸町1丁目2番2号					
				(72)発明者	坂本 有史					
					京京都千代田区内幸町1丁目2番2号	住友				
					ベークライト株式会社内					
				(72)発明者	竹田 敏郎	•				
					東京都千代田区内幸町1丁目2番2号	· 住友				
					ベークライト株式会社内					
				(72)発明者	竹田 直滋					
					東京都千代田区内幸町1丁目2番2号	· 住友				
					ベークライト株式会社内					
				1						

(54) 【発明の名称】熱圧着可能な導電性フイルム状接着剤

(57) 【要約】

【構成】 1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼンAモル及び式(1)で表わされるシリコーンジアミンBモル及び他のジアミン成分Cモルを含むアミン成分と、酸二無水物成分Dモルとを、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン又はシリコーンジアミンの少なくともどちらか一方を必須成分とし、(A+B)/(A+B+C+D)が0.3~0.55、(A+B+C)/Dが0.8~1.3の範囲で反応させ、少なくとも80%以上がイミド化されているポリイミドと、ポリイミドに対して50~900wt%の導電性フィラーとからなる熱圧着可能な導電性フィルム状接着剤。

【化1】

$$R_2N - R_1 - Si - O - Si - R_2 - NH_2 - \cdots$$
 (1)

 $(R_1,R_2:2価の炭柔数1~5の脂肪族基又は$ 炭素数6以上の芳香族基を示し、互に同じであっても異なっていてもよい。 $<math>R_3,R_4:1価の脂肪族基又は芳香族基を示し、$ 互に同じであっても異なっていてもよい。<math>n:1~100の整数)

【効果】 耐熱性に優れ、低温、低圧、短時間で熱圧着作業性が良好な、銅、シリコンなどの金属、セラミックスへの接着性に優れ、室温だけでなく、260℃のような半田溶融温度でも充分な接着強度を有し、かつ優れた導電性を有するフィルム状接着剤を得ることができる。

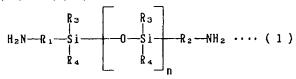
【特許請求の範囲】

【請求項1】 1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン Aモル及び式(1)で表わされるシリコーンジアミンB モル及び他のジアミン成分 Cモルを含むアミン成分と、酸二無水物成分 Dモルとを、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン又はシリコーンジアミンの少なくともどちらか一方を必須成分とし、(A+B)/(A+B+C*

1

*+D) が0.3~0.55、(A+B+C) / Dが0.8~1.3の 範囲で反応させ、少なくとも80%以上がイミド化されて いるポリイミドと、ポリイミドに対して50~900wt%の 導電性フィラーとからなる熱圧着可能な導電性フィルム 状接着剤。

【化1】



(R₁,R₂: 2価の炭素数1~5の脂肪族基又は

炭素数6以上の芳香族基を示し、

互に同じであっても異なっていてもよい。

R₃,R₄: 1価の脂肪族基又は芳香族基を示し、 互に同じであっても異なっていてもよい。

n:1~100の整数)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、導電性及び耐熱性に優れ、熱圧着して用いることのできるフィルム状接着剤に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、耐熱性の熱圧着可能なフィルム状 接着剤はいくつか知られている。例えば、特開平1-2822 83号公報には、ポリアミドイミド系やポリアミド系のホ ットメルト接着剤、特開昭58-157190号公報には、ポリ イミド系接着剤によるフレキシブル印刷回路基板の製造 法、特開昭62-235382号及び特開昭62-235383号公報に は、熱硬化性のポリイミド系フィルム状接着剤に関する 記述がなされている。ところが、ポリアミド系やポリア ミドイミド系樹脂は、アミド基の親水性のために吸水率 が大きくなるという欠点を有し、信頼性を必要とするエ レクトロニクス用途としての接着剤に用いるには限界が あった。またその他の公報に記載されているフィルム状 接着剤の熱圧着条件は、275℃、50kgf/cm²、30分間が 標準であり、熱や圧力に鋭敏な電子部品や、量産性を必 要とされる用途のフィルム状接着剤としては必ずしも有 利であるとは言えなかった。

【0003】一方で、従来用いられているエポキシ系、フェノール系、アクリル系等の接着剤は、比較的低温、低圧で熱圧着できるという利点を有するが、熱硬化型であるため、ある程度硬化時間を長く設ける必要があった。また熱可塑性樹脂をホットメルト型接着剤として用いることもよく行なわれるが、耐熱性に乏しい欠点を有している。

【0004】また一方で、IC、LSI等の半導体チップとリードフレームとの接合には、従来AuーSi共晶が用いられていたが、Auが高価なため、最近では導電性樹脂ペーストが主流になってきた。この種の導電性樹脂ペーストとしては、特開昭55-25482号又は52-107036号公報に開示されているように、通常エポキシ樹脂をバインダーとし、これに銀粉を混合した銀ペーストが作業性や接着性が良いため、主に使用されてきた。しかしながら、このようなペースト状接着剤は、①塗布量を厳密にコントロールしないと厚み制御ができないこと、②チップ側面へのペーストの違い上がりのあること、③表面加工したリードフレームに均一に塗布できない、等の不具合があり、これらを解決する方法として導電性並びに耐熱性を有するフィルム状接着剤が望まれていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、耐熱性に優れ、低温、低圧、短時間で熱圧着可能な導電性フィルム状接着剤を得んとして鋭意研究を重ねた結果、特定の構造を有するポリイミドに、導電性フィラーを必要量分散させフィルム化した接着剤が上記の目標を達成し得ることが判り、本発明を完成するに至ったものである。 40 その目的とするところは、導電性、耐熱性と熱圧着作業性を両立させたフィルム状接着剤を提供するにある。

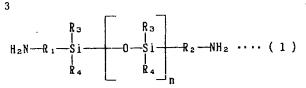
[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼンAモル及び式(1)で表わされるシリコーンジアミンBモル

[0007]

【化1】

9



(R₁,R₂: 2価の炭素数1~5の脂肪族基又は

炭素数6以上の芳香族基を示し、

互に同じであっても異なっていてもよい。 R3.R4:1個の脂肪族基又は芳香族基を示し、

互に同じであっても異なっていてもよい。

n:1~100の整数)

【0008】及び他のジアミン成分Cモルを含むアミン 成分と、酸二無水物成分Dモルとを、1,3-ビス(3-アミ ノフェノキシ)ベンゼン又はシリコーンジアミンの少な くともどちらか一方を必須成分とし、(A+B)/(A +B+C+D) が0.3~0.55、 (A+B+C) /Dが0.8 ~1.3の範囲で反応させ、少なくとも80%以上がイミド 化されているポリイミドと、ポリイミドに対して50~90 Owt%の導電性フィラーとからなる熱圧着可能な導電性 フィルム状接着剤である。

【0009】本発明において用いられる酸二無水物は、 特に限定されるものではないが、例を挙げると、ピロメ リット酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカ ルボン酸二無水物、2,2',3,3'-ベンゾフェノンテトラカ ルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ベンゾフェノンテトラカ ルボン酸二無水物、ナフタレン-2,3,6,7-テトラカルボ ン酸二無水物、ナフタレン-1,2,5,6-テトラカルボン酸 二無水物、ナフタレン-1, 2, 4, 5-テトラカルボン酸二無 水物、ナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水 物、ナフタレン-1,2,6,7-テトラカルボン酸二無水物、 4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサヒドロナフタレン-1, 2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、4,8-ジメチル-1,2, 3, 5, 6, 7-ヘキサヒドロナフタレン-2, 3, 6, 7-テトラカル ボン酸二無水物、2,6-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テ トラカルボン酸二無水物、2,7-ジクロロナフタレン-1, 4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-テトラクロ ロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、1, 4, 5, 8-テトラクロロナフタレン-2, 3, 6, 7-テトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニルテトラカルボン酸 水物、2,3,3',4'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水 物、3.3″、4.4″-p-テルフェニルテトラカルボン酸二無水 物、2,2",3,3"-p-テルフェニルテトラカルボン酸二無水 物、2,3,3″,4″-p-テルフェニルテトラカルボン酸二無水 物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)-プロパンニ 無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)-プロパ ン二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)エーテル 二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)メタン二無 水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メタン二無水 物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水

物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水 物、1,1-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)エタン二無水 物、1,1-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エタン二無水 物、ペリレン-2,3,8,9-テトラカルボン酸二無水物、ペ リレン-3,4,9,10-テトラカルボン酸二無水物、ペリレン -4.5.10.11-テトラカルボン酸二無水物、ペリレン-5.6. 11,12-テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレン-1, 2.7.8-テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレン-1, 20 2.6.7-テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレン-1, 2.9.10-テトラカルボン酸二無水物、シクロペンタン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸二無水物、ピラジン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3,4,5-テト ラカルボン酸二無水物、チオフェン-2,3,4,5-テトラカ ルボン酸二無水物、4,4'-オキシジフタル酸二無水物な どがあげられるが、これらに限定されるものではない。 【0010】本発明において用いられるジアミン成分 は、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン(以下AP Bと略す)とシリコーンジアミンと他のジアミンであ 30 る。他のジアミンは、特に限定されるものではないが、 例を具体的に挙げると、3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノ ビフェニル、4,6-ジメチル-m-フェニレンジアミン、2,5 -ジメチル-p-フェニレンジアミン、2,4-ジアミノメシチ レン、4,4'-メチレンジ-o-トルイジン、4,4'-メチレン ジ-2,6-キシリジン、4,4'-メチレン-2,6-ジエチルアニ リン、2,4-トルエンジアミン、m-フェニレン-ジアミ ン、p-フェニレン-ジアミン、4,4' -ジアミノ-ジフェニ ルプロパン、3,3'-ジアミノ-ジフェニルプロパン、4,4' -ジアミノ-ジフェニルエタン、3,3'-ジアミノ-ジフェニ 二無水物、2,2',3,3'-ジフェニルテトラカルボン酸二無 40 ルエタン、4,4'-ジアミノ-ジフェニルメタン、3,3'-ジ アミノ-ジフェニルメタン、4,4'-ジアミノ-ジフェニル スルフィド、3,3'-ジアミノ-ジフェニルスルフィド、4. 4'-ジアミノ-ジフェニルスルホン、3,3'-ジアミノ-ジフ ェニルスルホン、4,4'-ジアミノ-ジフェニルエーテル、 3,3'-ジアミノ-ジフェニルエーテル、ベンジジン、3,3' -ジアミノ-ビフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノ-ビフェニル、3,3'-ジメトキシーベンジジン、4,4"-ジア ミノ-p-テルフェニル、3,3"-ジアミノ-p-テルフェニ ル、ビス(p-アミノ-シクロヘキシル)メタン、ビス(p-β 50 -アミノ-t-ブチルフェニル)エーテル、ビス(p-β-メチ

ル-δ-アミノペンチル)ベンゼン、p-ビス(2-メチル-4-アミノ-ペンチル) ベンゼン、p-ビス(1, 1-ジメチル-5-ア ミノーペンチル)ベンゼン、1,5-ジアミノーナフタレン、 2,6-ジアミノ-ナフタレン、2,4-ビス(β-アミノ-t-プチ ル)トルエン、2,4-ジアミノ-トルエン、m-キシレン-2,5 -ジアミン、p-キシレン-2,5-ジアミン、m-キシリレン-ジアミン、p-キシリレン-ジアミン、2,6-ジアミノ-ピリ ジン、2,5-ジアミノ-ピリジン、2,5-ジアミノ-1,3,4-オ キサジアゾール、1,4-ジアミノ-シクロヘキサン、ピペ ラジン、メチレン-ジアミン、エチレン-ジアミン、プロ 10 限定されるものではないが、均一溶解可能なものなら ピレン-ジアミン、2,2-ジメチル-プロピレン-ジアミ ン、テトラメチレン-ジアミン、ペンタメチレン-ジアミ ン、ヘキサメチレン-ジアミン、2,5-ジメチル-ヘキサメ チレン-ジアミン、3-メトキシ-ヘキサメチレン-ジアミ ン、ヘプタメチレン-ジアミン、2.5-ジメチル-ヘプタメ チレン-ジアミン、3-メチル-ヘプタメチレン-ジアミ ン、4,4-ジメチル-ヘプタメチレン-ジアミン、オクタメ チレン-ジアミン、ノナメチレン-ジアミン、5-メチルー ノナメチレン-ジアミン、2.5-ジメチル-ノナメチレン-ジアミン、デカメチレン-ジアミン、1,10-ジアミノ-1,1 20 塩化メチレン、ジオキサン、シクロヘキサノン等があ 0-ジメチルーデカン、2,11-ジアミノードデカン、1,12-ジ アミノ-オクタデカン、2,12-ジアミノ-オクタデカン、 2,17-ジアミノ-アイコサンなどが挙げられる。

【0011】本発明における酸二無水物とジアミンの反 応は、公知の方法で行なうことができる。予め、酸二無 水物成分あるいはジアミン成分の何れか一方を有機溶剤 中に溶解あるいは懸濁させておき、他方の成分を粉末又 は液状あるいは有機溶剤に溶解した状態で徐々に添加す る。反応は発熱を伴うため、望ましくは冷却しながら反 応系の温度を室温付近に保って実施する。

【0012】ジアミン成分と酸二無水物成分のモル比 (A+B+C) / Dは、当量付近、特に0.8~1.3の範囲 にあるのが望ましい。何れか一方が多くなり過ぎると、 分子量が高くならず、耐熱性、機械特性が低下するので 好ましくない。室温付近で反応させ、ポリアミド酸を合 成した後、加熱あるいは無水酢酸/ピリジン系触媒を用 いる等公知の方法によりイミド化を実施することができ る。イミド化率は少なくとも80%以上であることが望ま しい。イミド化率が80%よりも低いと後にフィルム化し て熱圧着する際にイミド化が進行して水分が発生し、ボ 40 イドの原因となって接着強度の低下を招くので好ましく ない。

【0013】 (A+B) / (A+B+C+D) の値は、 0.3~0.55であることが必要であり、0.3未満であると熱 溶融性が低下してしまい、少なくとも300℃以上、ある いは50kgf/cm²以上の熱圧着条件が必要となり、量産性 の点で好ましくない。0.3以上であれば、250℃以下の温 度で、しかも20kgf/cm²以下の圧力下、10分以内の短時 間で熱圧着でき、良好な接着強度を達成することができ

【0014】本発明においては、APB又はシリコーン ジアミンの少なくともどちらか一方が必須成分として含 まれていることが必要である。APBとシリコーンジア ミンは、その構造上の特徴により、ポリイミド中に少な くともそのどちらか一方が上述のモル比を満たすように 含まれることによって、熱溶融性に優れ、接着強度も良 好であり、耐熱性とのバランスにも優れたフィルム状接

着剤を得ることができる。

【0015】本発明において用いられる有機溶剤は特に ば、一種類或いは二種類以上を併用した混合溶媒であっ ても差し支えない。この種の溶媒として代表的なもの は、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトア ミド、N,N-ジエチルホルムアミド、N,N-ジエチルアセト アミド、N,N-ジメチルメトキシアセトアミド、ジメチル スルホキシド、ヘキサメチルフォスホアミド、N-メチル -2-ピロリドン、ピリジン、ジメチルスルホン、テトラ メチルスルホン、ジメチルテトラメチレンスルホン、ッ -ブチロラクトン、ジグライム、テトラヒドロフラン、 り、均一に溶解できる範囲で貧溶媒を揮散調節剤、皮膜 平滑剤などとして使用することもできる。

【0016】本発明において用いられる導電性フィラー は、特に限定されるものではないが、通常好ましく用い られるものとして例を挙げると、金、銀、銅、ニッケ ル、アルミニウム等であり、使用目的に応じてこれらを 単独又は混合して用いることができる。通常、このよう な導電性フィラーの添加量は、樹脂に対して50~900% となるように用いるのが好ましい。50wt%未満では得ら 30 れるフィルム状接着層の導電性が発揮されないので好ま しくなく、900wt%を越えるとバインダーである樹脂分 が少なくなるために、充分な接着強度が得られなくなる ので好ましくない。形状は、特に制限されず、例えばフ レーク状、樹枝状や球状等のものがあり、これらの金属 粉末の一種又は二種以上を混合して用いてもよい。粒径 についても特に限定されないが、最終接着層の厚さ、作 業性等を考慮すると、平均粒径は、50 μm以下のものが 好ましい。

【0017】本発明の熱圧着可能な導電性フィルム状接 着剤の使用方法としては、特に限定されるものではない が、通常充分にイミド化されたワニスに導電性フィラー を加えて、公知の分散装置である三本ロール、ボールミ ル、擂潰機等により均一分散させ、ペースト状にしたも のを、テフロン等の離型性に優れた基材に塗布した後、 加熱処理によって溶剤を揮散させてフィルム化し、基材 から剥がして導電性フィルムを得る。これを被接着体間 に挟んだ後、熱圧着する。または予め被着体の上に塗布 した後、加熱処理を施して充分に溶剤を揮散させた後、 一方の被着体と合わせて熱圧着することもできる。

【0018】また本発明の接着剤のベース樹脂であるポ

リイミドには、必要に応じて各種添加剤を加えることが できる。例えば、基材に塗布する際の表面平滑剤、濡れ 性を高めるためのレベリング剤や各種界面活性剤、シラ ンカップリング剤、また接着剤の熱圧着後の耐熱性を高 めるための各種架橋剤などの添加剤である。これらの添 加剤は、フィルム状接着剤の特性を損わない程度の量で 使用することができる。

【0019】以下に実施例を以て本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでは ない。

[0020]

【実施例】

(実施例1)温度計、撹拌機、原料投入口、乾燥窒素ガ ス導入管を備えた四つ口のセパラブルフラスコ中に、1. 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン(APB) 14.62 g (0.05モル) 及び下記式のシリコーンジアミン (以下 G9と略す) 42.09g (0.05モル)

[0021]

【化2】

【0022】を300gのN-メチル-2-ピロリドン(NM P) に溶解させ、4,4'-オキシジフタル酸二無水物(O DPA) 31.02g (0.1モル) を30分間かけて粉状のまま 徐々に添加した後2時間撹拌を続けた。この間ずっと乾 燥窒素ガスを流しておき、更にODPAを添加する前か ら氷浴で冷却し、系を反応の間ずっと20℃に保っておい た。

【0023】次いで、この系にキシレン60gを添加し、 乾燥窒素導入管を外して、代りにディーンスターチ還流 冷却管を取付け、氷浴を外してオイルバスで加熱して系 の温度を上昇させる。イミド化に伴って生じる水をトル エンとの共沸により系外へ除去しながら加熱を続け、15 0~160℃でイミド化を進めて水が発生しなくなった5時 間後に反応を終了させた。このポリイミドワニスを30リ ットルのメタノール中に撹拌しながら1時間かけて滴下 し、樹脂を沈澱させ、濾過して固形分のみを回収した 後、真空乾燥機中にて減圧下120℃で5時間乾燥させ た。このようにして得られたポリイミドのFT-IRスペク トルを測定し、1650cm⁻¹に現れるイミド化前のアミド結 合に基づく吸収と、1780cm⁻¹に現れるイミド環に基づく 吸収からイミド化率を求めたところ、100%イミド化さ れていることが判った。

【0024】このポリイミドをジエチレングリコールジ メチルエーテル (ジグライム) に溶解させ、濃度10%に 調整した。このワニスに、平均粒径3μmの銀粉をポリ イミドに対して400wt%となるように加え、三本ロール を用いて均一に分散させ、ペースト状物を得た。このペ 50 加量以外は全て実施例1の方法と同様に行ない、表1の

ーストをアプリケータを用いて表面研磨されたテフロン 板の上にキャストし、乾燥機中で120℃、5時間加熱処 理をすることによって溶剤を揮散させ、テフロン基板か ら剥がして、厚み25μmのフィルムを作成した。このフ ィルムから、3mm×3.5mm角の大きさを切出し、銅製のリ ードフレームと、3mm×3.5mm角の大きさのシリコンチッ プの間に挟み、230℃のホットプレート上で500gの荷重 をかけ(約4.76kgf/cm²)、10秒で熱圧着した後、室温 まで冷却してプッシュプルゲージで剪断強度を測定した ところ、10kgf以上の値のところでシリコンチップが破 壊して正確な剪断強度が得られない程、強固に接着して いた。次に、260℃のホットプレート上に10秒間、同様 の接着サンプルを置いて剪断強度を測定したところ、1. 8kgfの強度が得られた。破壊のモードは凝集破壊であ り、リードフレームにもチップにもフィルムの一部が残 っていた。またフィルムにはボイドは全く認められなか った。このフィルムの体積抵抗率を測定したところ、1 $\times 10^{-1}$ [Ω -cm]であり、導電性に優れていることを確認

8

20 【0025】 (実施例2)酸無水物成分として、ODP A18.61g (0.06モル)、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテ トラカルボン酸二無水物 (BTDA) 12.89g (0.04モ ル) 及びジアミン成分として、APB14.62g (0.05モ ル)、G9 16.84g (0.02モル)、2,4-ジアミノトルエ ン(以下TDAと略す)4.89g(0.04モル)を用いた以 外は実施例1と同様の方法によってポリイミドを得、イ ミド化率を測定したところ、100%であった。

【0026】この樹脂をジグライムとブチルセルソルブ アセテート (BCA) の1対1混合溶媒で溶解し、濃度 30 15%に調整した。このワニスに、平均粒径 3 μmの銀粉 並びにニッケル粉を樹脂に対してそれぞれ300wt%、150 wt%となるよう添加し、三本ロールを用いて均一に分散 してペースト状物を得た。このペーストをアプリケータ を用いて表面研磨したテフロン板の上にキャストし、乾 燥機中で120℃、5時間加熱処理して溶剤を揮散させた 後、テフロン基板から剥がして厚さ25μmのフィルムを 作成した。このフィルムから3mm×3.5mm角の大きさを切 り出し、銅製のリードフレームと3mm×3.5mm角の大きさ のシリコンチップの間に挟み、250℃のホットプレート 40 上で500gの荷重を10秒かけ接着した。室温で剪断強度 を測定したところ、10kgf以上でシリコンチップが破壊 した。次に、260℃のホットプレート上に10秒間、同様 の接着サンプルを置いて剪断強度を測定したところ、3. 5kgfであった。接着フィルム面にはボイドは全く認めら れなかった。このフィルムの体積抵抗率を測定したとこ ろ、1.5×10⁻¹[Ω-cm]であり、導電性であることが確認 された。

【0027】(実施例3~5及び比較例1~5)ポリイ ミドの組成、イミド化時間、導電性フィラーの種類、添

10

9

*【表1】

結果を得た。 [0028]

表 1

	_															
		樹脂組成 (モル)			ا نا ج بر	را عر			747-	熱圧着条件			到新建度(kgf)			
	酸	無水物	٧	アミン	(時間)	イミド 化率 (%)	平均粒径	添加量 対機期 分(%)	温度 (*C)	圧力 kgf/cm²	時間 (秒)	室温	260°C	がかずか	体積 抵抗率 (Ω-cn)	
実施例3		*1(0.08) *2(0.01)		*3(0.07) *4(0.03)	5.0	100	銀	3 μ a	400	250	5	10	>10	2.7	無	1×10-4
実施例4	BTDA	(0.10)	APB G9	*5(0.07) (0.04)	5.0	100	銅銀	3 με 2 με	200 300	250	5	10	>10	3.7	無	1×10-4
実施例5	ODPA BTDA	*6(0.05) (0.04)		(0.08) (0.02)	5.0	100	銀沙功	¤س 2 ¤س 5	400 50	250	5	10	>10	6.0	無	1.5×10 ⁻⁴
比較例1	BTDA	(0.11)	APB G9 DDE	(0.01) (0.02) *7(0.07)	5.0	90	銀	2 μα	400	250	5	10	1.1	<0.5	無	1×10-4
比較例2	BPDA	(0.10)	APB G9	(0.07) (0.04)	5.0	100	鋖	Jμn	40	250	5	10	>10	1.5	無	1×10-1以上
比較例3	ВРОА	(0.10)	APB G9	(0.07) (0.04)	5.0	100	銀	3 <i>μ</i> n	1000	250	5	10	<0.5	<0.5	無	1×10-4以下
比較例4	BTDA	(80.0)	APB G9	(0.03) (0.03)	5.0	100	銀	3 µm	400	250	5	10	<0.5	<0.5	無	1×10-4
比較例5	ODPA BTDA	(0.04) (0.05)		(0.08) (0.03)	0.5	40	銀	2μ₽	400	250	5	100	<0.5	<0.5	有	1×10 ⁻¹ 以上

(注) *1:3,3',4.4'~\'ソゾフェノンテトラ加ポン酸二無水物 *2:3,3',4,4'-t'フェレテトラルギン酸二無水物 *3: CHs CHs

*4:2,4-ジアミノトルエン

HaN (CH2)3 \$1 (0-\$1) (CH2)3 NH2

*5:1,3-6' X(3-75/75/49)\\' yt' y *8:4,4'-村シシ' フタル酸二無水物

47:4,4°-ジアミノジフュニルエーテル

ÜЮ ĊΗ3

【0029】実施例1、2並びに表1の実施例3~5の ように、APBとシリコーンジアミンが全体の樹脂組成 のうち、モル数の割合で0.3~0.55であり、酸無水物と ジアミンのモル比が0.8~1.3の範囲にあり、イミド化率 が80%以上のポリイミドを用いて、導電性フィラーを樹 脂に対して50~900wt%の割合で均一分散させフィルム 化したものは、250℃以下の比較的低い温度で、しかも5 kgf/cm²という比較的低い圧力で、10秒間という短時間 の熱圧着条件で強固な接着強度が得られ、さらに260℃ という高温においても1kgf以上の接着強度を有してい た。また得られた接着フィルムの体積抵抗率で全て1× $10^{-3}[\Omega-cm]$ 以下であり、良好な導電性を有していた。 【0030】一方、比較例1のようにAPBとシリコー 40

ンジアミンの全体の樹脂組成に占める割合がモル比で0. 3未満となると、250℃、5kgf/cm2、10秒の熱圧着条件 では充分な接着強度が得られなかった。また、350℃、5 Okgf/cm²、1800秒でも、充分な高温時における接着強 度が得られなかった。比較例2のように、導電性フィラ 一の添加量が樹脂分に対して50wt%未満になると、充分

な導電性が得られなかった。また逆に比較例3のよう に、フィラーの添加量が900wt%を越えると、接着成分 である樹脂量が不足し、充分な接着強度が得られなかっ た。比較例4のように、酸二無水物とジアミンとの反応 の当量比が一方に極端にずれると、樹脂の分子量が上が らず、充分な接着強度が得られなかった。比較例5のよ うにイミド化率が80%未満であると、熱圧着後のフィル ム面にボイドが発生してしまうため、充分な接着強度が 得られなかった。以上のように本発明の条件以外では良 好な結果を得ることができなかった。

[0031]

【発明の効果】本発明の熱圧着可能なフィルム状接着剤 は、銅、シリコンなどの金属、セラミックスへの接着性 に優れており、室温だけでなく、260℃のような半田溶 融温度でも充分な接着強度を有する耐熱性に優れたもの である。また接着層は充分な導電性を有していた。しか も従来にない、低温、低圧、短時間で熱圧着できる量産 性の点においても有利な導電性フィルム状接着剤を得る ことができる。

(51) Int. Cl. ⁵ H O 1 L 21/52 識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

E 9055-4M